دراسة منحني الاستنبات ومعدل عمق التوقف للبوزترونات e^+ البطيئة في كبريتيد المغنيسيوم MgS

اصباح محمود امان الله 2صباح جلال فتحي اسيف عامر مهدي قسم الفيزياء-كلية العلوم جامعة تكريت حسلاح الدين- العراق ص.ب :42 قسم الفيزياء-كلية العلوم جامعة كركوك العراق

dr.sabah.ph.sc@tu.edu.com Saifamear76@yahoo.com

1-الملخص

يقدم هذا البحث القيم النظرية لمنحني الاستنبات (z,E) ومعدل عمق التوقف للبوزترونات z0 البطيئة بطاقة z1 البطيئة بطاقة z30-1.5 الكترون فولت لمركب كبريتيد المغنيسيوم z1 المتحصلة ، ان حجم منحني الاستنبات يعكس طيف طاقة البوزترونات الساقطة اذ ان معدل اعماق التوقف تكون قليلة جدا للطاقات الواطئة و ذلك بسبب وجود احتمالية كبيرة لحصول الارتداد الخلفي backscattering للبوزترونات الساقطة عند سطح المادة وبالنتيجة يكون عملية فناء محدودة تتمثل بالقيم العالية لمنحني الاستنبات ،واما بالنسبة لطاقات البوزترونات الاعلى نلاحظ تناقص قيم z1 اهذا السلوك ناتج من الاستطارة المتعددة multiple scattering المرنة والغير المرنة اثناء عملية التباطئ داخل المادة . الدراسة الحالية تنسجم مع در اسات سابقة لعناصر ومركبات اخرى.

الكلمات المفتاحية

افناء،استنبات البوزترون،الاتزان الحراري، دالة توزيع مايكوف،معدل عمق التوقف،عيوب البلورية .

ISSN 1992 - 0849

2_ المقدمة

ان استطارة الكترون والبوزترون وفقدانها للطاقة في المادة ذات اهمية كبيرة بمختلف المجالات البحثية مثل در اسات السطوح والمواد الصلبة وكذلك استخدام الكترون -البوزترون واطئة الطاقة في تقنية المجهر الالكتروني والتشخيص والعلاج الطبي [1] ان منحني الاستنبات او منحني التوقف stopping profile يمثل التوزيع المكاني لبوزترونات positron spatial distribution بعد حصول ظاهرة الاتزان الحراري Thermalization مع البيئة المحيطة بالبوزترون ضمن مادة الهدف وينتج هذا المنحنى من حقن بوزترونات واطئة الطاقة الى الطبقة التي تقع بعد سطح المادة [2] . فبعد حصول الاتزان الحراري داخل المادة يفني البوزترون مع الكترون منتجة بذلك فوتونين بطاقة 511keV و معدل افناء الزوج الكترون-بوزترون يعتمد على مدى تداخل السحب الكترونية-البوزترونية electron-positron cloudsفكما زادت الكثافة الالكترونية (تزايد السحب الالكترونية) حول البوزترونات في الموضع الذي يحصل فيه عملية الفناء ،ادى ذلك الى تناقص العمر الزمني lifetime للبوزترون [3] ان منحنى اجتذب اهتمام الباحثين نظريا وعمليا اذ انه يفسر البيانات الناتجة من طيف البوزيرونات البطيئة والمستخدمة في دراسة العيوب البلورية واما عمق الاختراق فهو عامل مهم لقياس اعمار lifetime البوزيرونات في اشباه الموصلات والمعادن إن العديد من معاملات الافناء مثل الطاقة _ زمن الانبعاث _زاوية انبعاث -الفوتونات المنبعثة تزودنا بمعلومات عن المادة التي حصل فيها ظاهرة الافناء و ان عملية احتجاز trapping البوزترون داخل العيوب البلورية يسبب الكثير من التغيرات في خواص البوزترونات المراد قياسها مثل عمر البوزترون والترابط الزاوي angular distribution لفوتونات الافناء والشكل (1)يمثل سلوك البوزترون وطرق التفاعل مع دخول المادة[4-5].

Investigation of the Implantation profile and average stopping depth of slow positrons e^+ in Magnesium Sulfide MgS

Saif Amear Mahdyi¹ ²Sabah jalal fatahy Sabah Mahmoud Aman Allah¹

¹Physics Department, College of Sciences –Tikrit University, P.Box.O:42, -Salah din -Iraq.

²Physics Department, College of Sciences –kirkuk University-Iraq

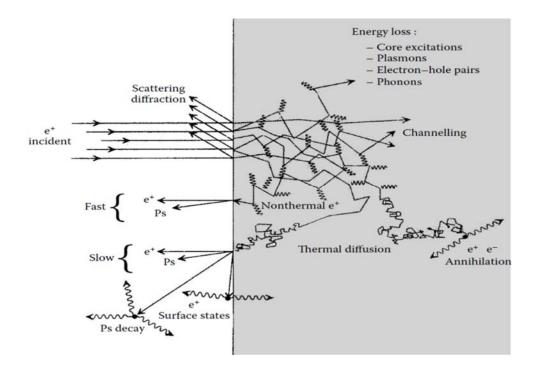
Saifamear76@yahoo.com dr.sabah.ph.sc@tu.edu.com

Abstract:

In this paper ,we present for the first time , the theoretical values of Implantation profile I(z,E) and average stopping depths z_0 of slow positron (1.5-30)keV for Magnesium sulfide MgS and different thicknesses(0.2-1.6) μ m by employing a Makhovs distribution function has been investigated . The obtained results reveals that the shape of the Makhov's profile indicates to the energy spectrum of the incident positrons ,the average stopping depth are small for low energies , this due to the probability of backscattering positrons at the surface of material and thus the result is a narrow annihilation region which represented by the high values of I(E,z), this behavior is due to the multiple scattering elastic and inelastic during the slowdown process inside material , the average stopping depths increased .The present study in accordance with the results of that for other works of elements and compounds.

ISSN 1992 - 0849

Keywords: Annihilation, average stopping depth, crystal defect, Makhov distribution function, implantation profile, Thermalization.



شكل (1) تفاعلات البوزترون داخل المادة الصلبة ، في هذا المخطط Ps يمثل ذرة البوزترونيوم positronium ، . [5] هما بوزترون والكترون على التوالي e^- هما بوزترون والكترون

منحنى الاستنبات البوزتروني متعدد الطاقات تم التحقق منه قبل[6] W.Brand and R Paulin حيث استخدم البوزترون للحصول على عمق المنحنى للعيوب البلورية والقريبة من السطح واجراء تحليل السطوح البينية interfaces للاغشية الرقيقة والانظمة متعددة الطبقات واقترح كل من -8] [7طريقة جديدة لدراسة منحني استنبات البوزترونات من خلال التعبير عن نسبة البوزترونات المارة خلال شريحة نحيفة جدا بطريقة التكامل للزاوية الصلبة وقام [9,2]بدراسة منحنى الاستنبات باستخدام عنصري الماس والجرمانيوم، اضافة الى ما ذكر العديد من الدراسات ولمختلف العناصر

ISSN 1992 – 0849

ضمن المراجع [13,12,11,10] .ان الهدف من الدراسة الحالية هو حساب منحني الأستوات ومنها البحاد معدل عمق التوقف للبوزترونات البطيئة(واطئة الطاقة) في كبريتيد المغنيسيوم MgS باستخدام دالة توزيع مايكوف ولأسماك مختلفة .

3-الحسابات النظرية

ان عدد البوزترونات التي يتم ايقافها عند سطح الشريحة والتي سمكها z تعطى بالمعادلة التجريبة الاتية[6].

$$P(\alpha, E) = 1 - \alpha e^{-\alpha z} \dots (1)$$

حيث ان α هو معامل امتصاص البوزترون والذي يعرف بوجب المعادلة الاتية [2]

$$\alpha(cm^{-1}) = 17 \frac{\rho}{E_{\text{max.}}^{1.43}} \dots (2)$$

حيث ρ (g/cm³) ميمثل الكثافة لكبريتيد المغنيسيوم وان ρ (g/cm³) مي طاقة البوزترون الساقط ولحساب منحني استنبات البوزترون ،باستخدام مشتقة دالة توزيع مايكوف Makhovs ولحساب منحني للعلاقة الاتية [14]:

$$I(z,E) = -\frac{d}{dz}[P(\alpha,E)] = -\frac{d}{dz}[e^{-(z/z_0)^m}] = \frac{mz^{m-1}}{z_0^m}e^{-(z/z_0)^m} \dots (3)$$

واما الدالة z فهي ترتبط بعمق الاختراق z_0 بموجب العلاقة[14]

$$z_0 = \frac{z}{\Gamma(1+1/m)} \dots (4)$$

حيث ان Γ هي دالة كاما في المعادلة Γ ،وبعد تعويض قيمة دالة كاما في المعادلة Γ ،تصبح [15].

$$z = 0.886z_0$$
(5)

Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)

Volume 12, Issue 3, June 2017 ISSN 1992 – 0849

وبما ان تعطى بالعلاقة ي

$$\overline{z} = \frac{AE^n}{\rho}$$
(6)

حيث ان كل من A و n هي ثوابت تجريبية . والقيم الاكثر استخداما لهذه المعاملات والتي تصف سلوك المادة [14]

$$A = 4 \mu g . keV^{-n} . cm^{-2}$$
.
 $m = 2$ (7)
 $n = 1.6$

وبعد تعويض قيم المعادلة 7 في معادلة 6و الناتج في المعادلة 5 نحصل على معدل عمق الاختراق $z_0(\mu m) = 1.5786 E^{1.6}(\mu m/keV^{1.6})....(8)$

م يمثل كثافة مركب كبريتيد المغنيسيوم والجدول الآتي يمثل بعض الخواص الفيزيائية لمركب كبريتيد المغنيسيوم .

جدول رقم (1)يمثل بعض الخواص لمركب كبريتيد المغنيسيوم [16-17].

القيمة	الخاصية الفيزيائية
0.5203nm	ثابت الشبيكة
مكعب	النظام البلوري
2.86g/cm^3	الكثافة
4.5eV	فجوة الطاقة
56.38g/mol.	الوزن الجزئي
2000°C	درجة الانصهار

ISSN 1992 - 0849

4- النتائج والمناقشة

تعتبر عملية انتقال البوزيرون داخل المادة عملية معقدة وبشكل عام تحدث تفاعلات البوزيرون المستنبتة داخل المادة الصلبة الى ثلاثة مراحل: الاستنبات ،الاتزان الحراري والانتشار diffusion الذي ينتهي بالإفناء مع الكترونات حيث لا توجد أي حدود فاصلة بين المراحل الثلاثة المذكورة ،و تعتبر عمليتي الاتزان الحراري والانتشار ذات تأثير قليل على قيم منحنى الاستنبات ،ذلك لا نه اثناء هذه العمليتين ،يتحرك البوزترون معدل مسافة تقدر ب [مايكرومتر [18]ومع ذلك فان معظم عمر البوزترون(⁷⁻¹⁰⁻¹² ثانية) [19] يستنفذ في الانتشار (او ما يعرف بالانتقال العشوائي random) walk عبر الفراغات الذرية البينية ،حيث بفعل قوة التنافر الكولومي strong Coulomb repulsion للأيونات الموجبة في داخل المركب كبريتيد المغنيسيوم ،فإن الدالة الموجية تتركز في الفراغات الذرية البينية وتتغير الدالة الموجية للبوزترون بشكل كبير بالمناطق القريبة في الشبيكة البلورية حيث توجد فجوة gapفي دوريتها periodicity،فعلى سبيل المثال بسبب وجود الفجوات vacancy في الشبيكة (ذرة مفقودة) ، يمكن بسهولة توليد المزيد من العيوب المعقدة vacancy defects فاذا ازيلت ذرة في الشبيكة الدورية البلورية ،فان الجهد الكهروستاتيكي الموضعي سوف تتغير والكثافة الكترونية الموضعية سوف تتناقص . اما بالنسبة للكترونات الغير متمركزة delocalized electrons والمتواجدة في الفراغات الشبكية تنشئ شحنة موجبة في هذه المنطقة ، وهذا يعنى ان تكوين الجهد الجاذبي للبوزترون ،هذا الجهد يكون من القوة بمكان ان يحدث حالة مقيدة للبوزترون positron bound state (حالة ممركزة localized state)في المواضع الفراغية في الشبيكة البلورية إن عملية انتقال البوزترون الى الحالة المركزة يشار اليها باسم المصيدة او الحجز trap وهذه العيوب تعرف باسم مراكز احتجاز البوزترون [5] في الحقيقة ان طبيعة مراكز احتجاز البوزترون في المواد شبه الموصلة مثلا MgS يكون اكثر تعقيدا بالمقارنة مع المعادن ،و هذا بسبب رئيسي ناتج من حقيقة ان البوزترون كشحنة موجبة ليكون حساسا للحالات المشحونة في العيوب البلورية [20]عادة تكون العيوب في اشباه الموصلات والمعادن من نوع الحجم المفتوح open volume type مثل الفراغات vacancies ، شوائب معقدة volume type dislocations، حدود الحبيبية grain boundaries، التجاويف cavities، سطوح بينية وحتى الرواسب precipitates يمكنها ان تحدث جهود تجاذبيه وبهذا يتكون مراكز احتجاز

ISSN 1992 – 0849

للبورترون ان معدل الاحتجاز ودرجة التمركز للبورترونات تعتمد بشكل كبير على و البلوري وعلى خواصه الفيزيائية من ملاحظة الشكل (2) والجدول رقم (2)عند مدى الطاقة (5.1-4) كيلو الكترون فولت فان معدل اعماق التوقف في كبريتيد المغنيسيوم تكون قليلة جدا ويمكن تفسير ذلك بسبب وجود احتمالية كبيرة بالارتداد الخلفي للبورترونات المعققة افناء backscatteringضيقة عنه تناقص الكثافة الالكترونية عند سطح المادة وبالتالي يكون منطقة افناء mililationضيقة تتمثل بالقيم الكبيرة لمنحني الاستنبات (لاحظ شكل 3) ، حيث انه بزيادة طاقات البورترونات الساقطة على شبه الموصل كبريتيد المغنيسيوم نلاحظ تناقص قيم (E,z) وخصوصا لقيم على مدى -1600) slow down process المرنة slow down process المرنة المولي يمكن تفسيره على انه ناتج من الاستطارة المتعددة والسات المولية الموركب . لحد علم الباحثين ،لم نجد دراسات علمية سابقة نظرية او عملية خاصة بمنحني ،داخل المركب . لحد علم الباحثين ،لم نجد دراسات علمية سابقة نظرية او عملية خاصة بمنحني الاستنبات ومعدل عمق الايقاف للبورترونات في مركب نتريد البورون لغرض اجراء المقارنة ضمن عبراسات سابقة والاسماك المدروسة في البحث الحالي آلا انه ومع ذلك فأننا عندما نقارن دراستنا الحالية مع البحوث نتافجنا الحالية مع البحوث المذكورة اعلاه واما معدل اعماق التوقف (الاختراق) للبورترونات المستنبتة داخل شبه الموصل ،فأن نتائجنا الحالية في انسجام جديد مع نتائج الدراسات السابقة لعناصر [22,219].

5-الاستنتاجات

في ضوء الدراسة الحالية يمكن ايجاز الاستنتاجات التي تم التوصل اليها:

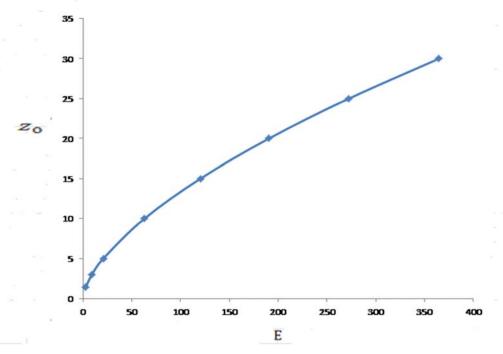
أ-تناسب طاقة البوزترون الساقط طرديا مع عمق الاختراق وعكسيا مع منحني الاستنبات في مركب كبريتيد المغنيسيوم .

ب- احتجاز البوزترون في العيب البلوري، يعني ان الدوال الموجية لهذه البوزترونات ضمن ذلك العيب البلوري حتى يتم افناها في الشبيكة.

ج- معاملات فناء البوزترون مثل الطاقة – زمن الانبعاث –زاوية انبعاث تكون حساسة لعيوب الشبيكة البلورية .

Kirkuk University Journal / Scientific Studies (KUJSS)

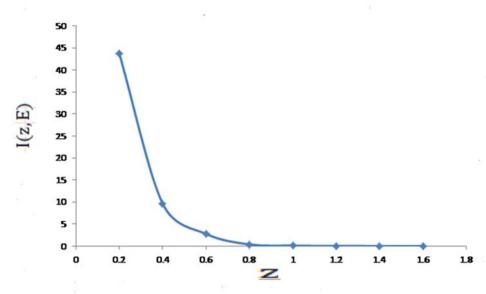
Volume 12, Issue 3, June 2017 ISSN 1992 – 0849



شكل(2)معدل عمق التوقف كدالة لطاقة للبوزترونات الساقطة بوحدة كيلو الكترون فولت .

Kirkuk University Journal / Scientific Studies (KUJSS)

Volume 12, Issue 3, June 2017 ISSN 1992 – 0849



. z البوز ترونات كدالة لعمق z البوز ترونات كدالة لعمق النظرية لمنحني استنبات الريان البوز ترونات كدالة العمق

ISSN 1992 - 0849

6_المصادر

[1] Asuman Aydin, 2001. Monte Carlo calculations of positron implantation

profile and backscattering probilities in gold.p.p87-90, Nukleonika, 46(3):

[2] Sabah Mahmuoud Aman Allah Luma saad Abdual Baqi Najat Ahmad

Daham Saif Amear Mahdyi(2015)(Implantation profile for low energy

positrons in diamond.p.p.105-111,Al-Qadasia Journal for scienceVol.20, No.4

[3] O.M.Osiele ,2006 .Depth profling of Aluminium metal using slow

positron beam. p.p19-23, Nigerian Journal of physics 18(1)

[4]Emilio Serger.1977. Nuclei and particle-an introduction to nuclear and

sunnuclear phsics)Ch.2,p.p 74-78,W.A. Benjamin, Inc, Massachusetts, UK.

[5] J.J.Pedroso de Lima, 2011. Nuclear Medicine physics .Ch.3p.69-94, Taylor

and Francis Group, LLC Taylor & Francis is an Informal Business, USA.

[6] W.Brand and R Paulin, 1977. positron implantation—profile effects in

solids p.2511, Phy .Rev. B15, North Holland .

[7] K. Plotkowski, T.J. Panek, J. Kansy, 1994, p.p. 2643 J. Phys.,

Condens. Matter 6.

[8] N. DJOURELOV AND M. MISHEVA, 1996. SOURCE CORRECTION IN POSITRON

ANNIHILATION LIFETIME SPECTROSCOPY. P.P.2081, J. PHYS.: CONDENS.

MATTER, 8.

[9]Sabah Mahmuoud Aman Allah .2015. Verification Makhov, s profile for

slow positron in Germanium.p.p.83-86, Tikrit Journal of Pure Science 20 (4).

ISSN 1992 - 0849

- [10] H.L.MansourW.A. Jabbar.2015. Determination of Positrons Implantation Profile, Flux of Positrons and Fraction of Positrons Absorbed in Polystyrene-(Anthraquinone Copolymer)p.p324-328, 21th Scientific conference of college of education, Al-Mustansaryia University, Baghdad, Iraq.
- [11] J. Dryzek and E. Dryzek, (2006). Positron Implantation Profile in *Kapton.* p.p.577 Acta Physics Polonica A, 110.
- [12] K. Siemek and J. Dryzek, Acta Physica Polonica A. 2014. (The computer code for calculation of the positron distribution in a layered stack system. P.p833-836, Vol. 125, No. 3.
- [13] Paweł Horodek, and Jerzy Dryzek .2010. GEANT4 simulation of implantation profiles for positrons injected in solids from radioactive sources 22 Na and 68 Ge / 68 Ga , p.p.17–19, NUKLEONIKA;55(1).
- [14] S.Valkealahti and R.M. Nieminen.1983.Monte-Carlo Calculations of keV Electron and Positron Slowing Down in Solids. p.p. 95-106.Appl.Phys. A 32,.
- [15] A.F. Mahkov.1961. The Penetration of electrons into solids. p.p.1934-1945, Sov. Phys. Solid State 2.
- [16]W. Martienssen and H. Warlimont .2005. Springer Handbook of Condensed Matter and Materials Data, p.p. 576-600, part 4, Spinger Berlin Heidelberg Germany.
- [17] Karl Heinz Büchel, Hans-Heinrich Moretto, Dietmar Werner, 2000.Industrial Inorganic Chemistry-2d edition, John Wiley & Sons, ISBN 978-3-527-61333-5
- [18]J.Dryzek and Duga singleton.2006.implantation profile and linear absorption coefficients for positrons injected in solids from radioactive sources 22 Na and

ISSN 1992 - 0849

 $^{68}Ge/^{68}Ga$. p.p.197-204nuclear instrument and methods in physics research B252,Elseiver,USA.

[19] A. Vertes, Sandor Nagy, Zoltan Klencsar, Rezso G.lovas, Frank Rosch. 2011. Handbook nuclear chemistry-second editions, ch. 27, p. 1462-1466, Springer, New York, USA.

[20]R. Krause , Rehberg and H.S.Leipner.1999. positron annihilation in semiconductors. Ch.2 ,p.40-44, Springer, Germany .

[21]Baker J.A., Chilton N.B., Jensen K.O.Walker A.B. and Coleman P.G.1999. Median penetration depths and implantation profile for low energy in Al J.phys.condens.Matter 3, p.4109.

[22] S.Valkealahti and R.M. Nieminen.1984. Monte-Carlo Calculations of keV Electron and Positron Slowing Down in Solids,p.51,II Appl. Phys. A 35,.